

RAFALD

1^{er} Workshop Réseau des Acteurs Français de l'ALD



16 -17 -18 Novembre 2015

Minatec et Campus Est, Grenoble, France

Ce premier **Workshop**, dédié à la technologie **ALD** (Atomic Layer Deposition), a pour but de fédérer une communauté française, industrielle et académique, afin d'initier la **création d'un réseau national**.

Domaines Microélectronique, **Energie**, **Textile**, **Biologie**, **Nanotechnologies**...
Public Chercheurs, **Enseignants**, **Ingénieurs**, **Doctorants**, **Techniciens**, **Etudiants**

Soumission des résumés: date limite 31 Juillet 2015

www.rafald.org

PROGRAMME

Lundi 16

MINATEC CAMPUS	13.00 - 14.00	Accueil
	14.00 - 14.30	Introduction
	14.30 - 17.00	Tutoriels, Historique et principes de base de l'ALD (F. Donsanti), Précurseurs (S. Danièle), Equipements (J. Kools), Applications actuelles et émergentes (C. Vallée)
	17.00 - 19.00	Session Posters

Mardi 17

MINATEC CAMPUS	08.00 - 12.30	Simulations et Précurseurs
	14.30 - 19.00	Croissance, Caractérisations et Applications émergentes
	20.00 - 23.00	Dîner de Gala

Mercredi 18

CAMPUS EST	09.00 - 12.30	Présentation du Labex CEMAM, Equipements ALD
	14.00 - 16.00	Construction du Réseau RAFALD, Réseau EU COST HERALD

Frais d'inscription :
100€ / 60€ (doctorants)

Limité à 100 places

Contact: rafald@simap.grenoble-inp.fr

ANNEALSYS

Kurt J. Lesker
Company

AIR PRODUCTS

APPLIED MATERIALS



MICROTEST
Equipment & Consumables for the semiconductors and hybrids.

JACOMEX
DEPUIS 1945

SEMILAB

Beneq

AIR LIQUIDE
ADVANCED BUSINESS & TECHNOLOGIES

Swagelok

Altatech

Lyon

SIGMA-ALDRICH

COMITE SCIENTIFIQUE

N. Bahlawane (LIST) - S. Bellardie (Air Product)
D. Blanc-Pelissier (INL) - N. Blasco (Air Liquide)
M. Cassir (Chimie Tech Paris) - S. Daniele (IRCELYON)
J.-M. Decams (Annealsys) - F. Donsanti (EDF)
A. Esteve (LAAS) - M. Gros-Jean (STMicronics)
J. Kools (Encapsulix) - F. Neuilly (IEMN)
P. Carroy (INES) - L. Santinacci (CINAM)
C. Valhas (CIRIMAT) - J. Vitiello (Altatech)

COMITE LOCAL

E. Blanquet (SIMaP) - R. Boichot (SIMaP)
L. Cagnon (Institut NEEL) - R. Gassilloud (CEA/Leti)
C. Jiménez (LMGP) - T. Maindron (CEA/Leti)
A. Mantoux (SIMaP) - D. Muñoz-Rojas (LMGP)
C. Vallée (LTM)

leti

TOKYO ELECTRON

MINOS

arc
COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE ACADÉMIQUE Alpes-Alpes

cnrs

cea tech
FROM RESEARCH TO INDUSTRY

lanef
Laboratoire Avancées
Nanosciences-Energies
du futur

STREM

INSTITUT CARNOT
Energies du futur

nanoSCIENCES
FONDATION

CEMAM
Laboratoire d'excellence

Université Joseph Fourier
GRENOBLE

Grenoble INP